

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 1 区分  
 【発行日】平成 26 年 6 月 19 日 (2014.6.19)

【公表番号】特表 2013-531862 (P2013-531862A)  
 【公表日】平成 25 年 8 月 8 日 (2013.8.8)  
 【年通号数】公開・登録公報 2013-042  
 【出願番号】特願 2013-508575 (P2013-508575)  
 【国際特許分類】

H 0 5 B 6/64 (2006.01)

H 0 5 B 6/68 (2006.01)

F 2 4 C 7/02 (2006.01)

【F I】

H 0 5 B 6/64 Z

H 0 5 B 6/68 3 1 0 Z

F 2 4 C 7/02 3 2 0 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 4 月 24 日 (2014.4.24)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

少なくとも 1 つの放射素子により、空洞の中の対象物に、1 M H z 乃至 1 0 0 G H z の周波数範囲内の 1 又は複数の周波数の電磁エネルギーを加えるための装置であって、

エネルギー印加区域内の第 1 の領域及び第 2 の領域を、前記第 1 及び第 2 の領域に加えられる第 1 の量の R F エネルギー及び前記第 1 の量のエネルギーとは異なる第 2 の量の R F エネルギーにそれぞれ関連させ、

複数の電磁場パターンから複数のフィールドパターンを選択して、前記第 1 及び第 2 の領域にエネルギーの印加を向け、

前記第 1 の量の R F エネルギーを前記エネルギー印加区域内の前記第 1 の領域に加え、前記第 2 の量の R F エネルギーを前記エネルギー印加区域内の前記第 2 の領域に加えるために、前記エネルギー印加区域内の選択されたフィールドパターンを励起することによって、供給源を調整する、

ように構成されるプロセッサ

を含むことを特徴とする装置。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の装置において、前記少なくとも 1 個のプロセッサが、前記第 1 の領域および前記第 2 の領域の位置を区別するように構成されることを特徴とする装置。

【請求項 3】

請求項 1 又は 2 に記載の装置において、前記少なくとも 1 個のプロセッサが、複数の異なる電磁場パターンを逐次的に選択するように構成されることを特徴とする装置。

【請求項 4】

請求項 1 乃至 3 の何れか 1 項に記載の装置において、前記少なくとも 1 個のプロセッサが、各領域内で散逸される前記エネルギーについての指示に基づいて、前記第 1 の領域および前記第 2 の領域にエネルギーを加えるように構成されることを特徴とする装置。

【請求項 5】

請求項 1 乃至 4 の何れか 1 項に記載の装置において、前記供給源が、複数の放射素子により電磁エネルギーを供給するように構成され、前記少なくとも 1 個のプロセッサが、異なる振幅を有するエネルギーを少なくとも 2 つの放射素子に同時に供給するために、前記供給源を調整するように構成されることを特徴とする装置。

【請求項 6】

請求項 1 乃至 5 の何れか 1 項に記載の装置において、前記少なくとも 1 個のプロセッサは、前記第 1 の領域に加えられるエネルギー量が前記第 2 の領域に加えられるエネルギー量と異なり、前記第 1 の領域内で吸収されるエネルギーが、前記第 2 の領域内で吸収される前記エネルギーと実質的に同じであるよう、前記供給源を制御するように構成されることを特徴とする装置。

【請求項 7】

請求項 1 乃至 6 の何れか 1 項に記載の装置において、前記少なくとも 1 個のプロセッサが、

前記エネルギー印加区域内の前記対象物の空間的位置を示す情報を求め、

前記対象物の前記空間的位置の第 1 のエリアに対応する第 1 の高強度領域を有する第 1 のフィールドパターンを識別し、

前記対象物の前記空間的位置の第 2 のエリアに対応する第 2 の高強度領域を有する第 2 のフィールドパターンを識別することにおいて、前記第 1 のエリアは前記第 2 のエリアと異なる、第 2 のフィールドパターンを識別し、

前記供給源を制御して前記エネルギー印加区域に前記第 1 のフィールドパターンおよび前記第 2 のフィールドパターンを適用するように構成されることを特徴とする装置。

【請求項 8】

プロセッサにより調整される電磁エネルギーの供給源を用いて、空洞の中の対象物に、1 MHz 乃至 100 GHz の周波数範囲内の 1 又は複数の周波数の電磁エネルギーを加えるための方法であって、当該方法が、

前記プロセッサによって、第 1 の領域に加える第 1 の量のエネルギー及び第 2 の領域に加える第 2 の量のエネルギーを割り当て、前記プロセッサによって、複数の電磁場パターンから複数のフィールドパターンを選択して、前記第 1 及び第 2 の領域にエネルギーの印加を向けるステップと、

前記第 1 の量のエネルギーを前記第 1 の領域に加え、前記第 2 の量のエネルギーを前記第 2 の領域に加えるために、前記エネルギー印加区域内の選択されたフィールドパターンを励起することによって、前記供給源を調整するステップと、

を具え、

前記第 1 の量のエネルギーが、前記第 2 の量のエネルギーとは異なることを特徴とする方法。

【請求項 9】

請求項 8 に記載の方法において、前記第 1 及び第 2 の量のエネルギーが、前記プロセッサによって決定されることを特徴とする方法。

【請求項 10】

請求項 8 又は 9 に記載の方法において、

加えることには、前記エネルギー印加区域内に 2 つ以上の定在波を与えることが含まれ、前記定在波のそれぞれは、少なくとも 1 つの高強度領域と、少なくとも 1 つの低強度領域とを有し、高強度領域に関連するフィールド強度は、低強度領域に関連するフィールド強度よりも強く、調整するステップは、少なくとも 1 つの高強度領域が前記対象物の少なくとも一部の位置に一致する前記定在波の少なくとも 1 つを選択するステップと、前記選択した前記定在波の少なくとも 1 つを前記エネルギー印加区域に加えるステップとを含むことを特徴とする方法。

【請求項 11】

請求項 8 乃至 10 の何れか 1 項に記載の方法において、当該方法が、

前記エネルギー印加区域内の前記対象物の空間的位置を示す情報を求めるステップと、

前記対象物の前記空間的位置の第１のエリアに対応する第１の高強度領域を有する第１のフィールドパターンを識別するステップと、

前記対象物の前記空間的位置の第２のエリアに対応する第２の高強度領域を有する第２のフィールドパターンを識別するステップにおいて、前記第１のエリアは前記第２のエリアと異なる、第２のフィールドパターンを識別するステップと、

前記供給源を制御して前記エネルギー印加区域に前記第１のフィールドパターンおよび前記第２のフィールドパターンを適用するステップと、  
を含むことを特徴とする方法。

**【請求項１２】**

請求項１１に記載の方法において、前記エネルギー印加区域内の前記第１の領域および前記第２の領域の位置を、前記第１のエリアおよび前記第２のエリアに従って決定するステップをさらに含むことを特徴とする方法。

**【請求項１３】**

請求項１１に記載の方法において、前記第１のエリア内で吸収されるエネルギーが、前記第２のエリア内で吸収される前記エネルギーと実質的に同じであるよう、前記供給源を制御するステップをさらに含むことを特徴とする方法。

**【請求項１４】**

請求項８乃至１１の何れか１項に記載の方法において、前記第１の領域内で吸収されるエネルギーが、前記第２の領域内で吸収される前記エネルギーと実質的に同じであるよう、前記供給源を制御するステップをさらに含むことを特徴とする方法。